

Purificatore Di Gas Da Laboratorio Ad Alta Purezza Per Atmosfere Inerti E Gas Di Processo Ultra Puliti

Numero articolo: KT-JH



introduzione

Scopri il nostro purificatore di gas da laboratorio ad alta purezza progettato per l'erogazione continua di gas inerte ultra pulito. Rimuovendo efficacemente umidità e ossigeno a livelli inferiori al ppm, questo sistema garantisce l'assoluta integrità dell'atmosfera per strutture di ricerca avanzate in CVD, sintesi di semiconduttori e metallurgia.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Semiconduttori ed epitassia a film sottile	Eroga gas di trasporto (carrier gas) ultra puro come argon o azoto direttamente nelle camere CVD, PECVD e ALD durante la lavorazione dei wafer.	Previene l'ossidazione del substrato, riduce al minimo i difetti di microforatura (pinhole) e assicura un'elevata uniformità del film attraverso delicati strati atomici.
Trattamento termico in atmosfera inerte	Purifica i flussi di gas di protezione per forni a tubo, forni ad atmosfera sottovuoto e unità di sinterizzazione dentale che lavorano leghe reattive.	Elimina la formazione di incrostazioni superficiali e la decarburazione su titanio, zirconio e superleghe refrattarie durante i cicli ad alta temperatura.
R&S di batterie al litio e a stato solido	Condiziona le atmosfere protettive all'interno di glove box, linee di assemblaggio di celle pouch e stazioni di formulazione dell'elettrolita.	Protegge gli anodi di litio metallico e le chimiche degli elettroliti solidi sensibili all'umidità da degradazioni catastrofiche causate dall'umidità.
Produzione di fibre ottiche e fotovoltaico	Purifica l'atmosfera di processo durante la trafilatura delle preforme, la produzione di lingotti di silicio e la deposizione di strati di contatto passivati sui wafer.	Previene le bande di assorbimento dell'ossidrile (OH) nel vetro di silice e preserva la durata dei vetri nelle celle solari ad alta efficienza.
Produzione additiva e stampa 3D	Ricircola e raffina i gas di protezione inerti all'interno delle camere di costruzione a fusione laser selettiva (SLM) e a fusione a fascio elettronico (EBM).	Mantiene livelli di ossigeno eccezionalmente bassi per prevenire spruzzi, porosità e fragilità nella stampa di metalli reattivi.
Alimentazione di gas di trasporto per strumentazione analitica		